





Splendor and Mystery of the Royal Tombs of the Mochica Culture

PIXE, RBS and ICP-MS Analysis of a Moche Archeological Artifact

Manfredo H. Tabacniks Instituto de Física USP

- Erich Saettone
- José AS da Matta
- Ricardo M. O. Galvão
- José F. D. Chubaci
- Walter Alva (Museu Brüning, Peru)
- Márica CA Fantini
- Pedro Kiyohara

A cultura Mochica

- Viveu no Vale Mocha, junto aos Andes, norte do Peru, 1 AC e 7 DC.
- Sociedade com grande desenvolvimento tecnológico, artístico e uma complexa organização.
- Inovaram na tecnologia e metalurgia, com extensivo uso de cobre para ornamentos, armas e ferramentas.
- Desenvolveram uma sofisticada técnica para douração do cobre por uma camada de ouro extremamente fina e homogênea.



Em 1987 com a descoberta da Tumba Real de Sipán, (Sipán = Templo da Lua) temos pela primeira vez um vislumbre do explendor e grandiosidade de seus soberanos e podemos reconstruir a história dessa extraordinária cultura (Walter Alva, 2000).

O funeral do Lorde de Sipán e 8 companheiros, 300DC.

W. Sipan, Discovery and Research, Lime, Quebecor Perú,

Câmara funerária



Alva, W. Sipan, Discovery and Research, Lima: Quebecor Perú, 2000.



Craftwork technology "sheet-metal work"

- Electrochemical replacement plating
- Depletion gilding or silvering

ELECTROCHEMICAL REPLACEMENT PLATING



Alkalize the solution to pH = 9

A fine gold coating can be formed on copper by dipping it in the solution for approximately 5 minutes. The golden film can be fixed by annealing it at 500 to 800 °C.

DEPLETION GILDING



Remove the silver on the surface using a corrosive mineral mixture

Lechman, 1984. Sci. Am. 250 38



peça para análise



Chocalhos cencerros



LIMPEZA

Pincel umedecido com acetona;

Limpeza por desbaste atômico em reator de plasma ECR (*Electron-Cyclotron-Resonance*) em câmara de vácuo.
Plasma de argônio, 2 x 10⁻⁵ mbar.
Fonte RF 13,56Mz, 40W

> Laboratório de Física de Plasmas, IFUSP Erich Saettone, Prof. Ricardo M.O.Galvão





e⁻ temperature = 12eV $n_e = 5.10^{15} \text{ m}^{-3}$ plasma potential = 25 V RF power = 40 W

Resultado da limpeza por plasma





Análise de Materiais por Feixe Iônico

Feixes (haz) de íons com ~2 MeV

RBS Rutherford Backscattering Spectrometry

Concentração absoluta (at/cm²) e perfil em profundidade Alcance (feixe com 2MeV): H⁺ ~30µm, He⁺ ~2µm Sensibilidade < 10¹² Au/cm² Rápido (~10min)

PIXE Particle Induced X-Ray Emission

Concentração absoluta (at/cm²) Alcance (feixe com 2MeV): H⁺ ~30µm Sensibilidade < 10¹² Au/cm² ou ~ppm *bulk* Alta resolução para elementos vizinhos Rápido (~10min)





LAMFI - Laboratório de Análise de Materiais com Feixes lônicos

PIXE Particle Induced X-Ray Emission





RBS Rutherford Backscattering Spectrometry

Estratégia de Análise



Análise PIXE da mancha dourada



Espectro RBS da mancha dourada e sua simulação teórica

feixe de He⁺, 2,4 MeV (alcance ~2 µm)



Espectro RBS da mancha dourada e sua simulação teórica

feixe de H⁺, 2,4 MeV (alcance ~20 μm)



Composição relativa da "mancha dourada"



Espectro RBS da região negra (matriz) feixe de He⁺, 2,4 MeV (alcance ~2 µm)





Dra. Márcia de A. Fantini, Laboratório de Cristalografia, IFUSP

Análise ICP-MS com laser ablation

ELAN 6000 - Perkin Elmer

Laser Nd:YaG, 10mJ por "tiro". Furos com 10 ou 30µm de profundidade e cerca de 30 µm de diâmetro. 320 "tiros" em 90s.

Escolhidos tres pontos na amostra:

- mancha dourada
- matriz superfície (região negra)
- matriz fundo (região negra, ~20µm)

Perfil em profundidade para alguns elementos (Au, Cu, Ag, O, Cl..)

Uma análise para "todos" os elementos nos mesmos tres pontos.

ICP-MS

Ar



gás

íons

aerosol

ICP-MS

sampler and skimmer cones lente injetor

spray chamber

tocha de plasma 6000°C

amostra nebulizada válvula alto vácuo filtro quadrupolo eletrostático

Vácuo 10⁻⁵ t

detector

REPORT OF LESS

ICP-MS: limites de detecção (líquidos)



Análise ICP-MS com laser ablation (mancha dourada)



Análise ICP-MS com laser ablation (matriz fundo)



Análise ICP-MS com laser ablation (matriz fundo)



Análise ICP-MS: razão elementar para o Cu e Au



Análise ICP-MS: razão elementar para o Si



🗆 matriz raso

matriz fundo

□ dourado





Conclusões

Um exemplo do poder do uso combinado de várias técnicas analíticas derivadas da tecnologia da física nuclear para explorar uma amostra arqueológica;

Um fascinante exemplo de nanotecnologia Moche







manfredo@if.usp.br

www.if.usp.br/LAMFI

J. Phys. D. Applied Phys. 36 (2003) 842-48.